

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年10月30日(2014.10.30)

【公開番号】特開2014-82324(P2014-82324A)

【公開日】平成26年5月8日(2014.5.8)

【年通号数】公開・登録公報2014-023

【出願番号】特願2012-229198(P2012-229198)

【国際特許分類】

H 01 L 21/205 (2006.01)

C 23 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/205

C 23 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月16日(2014.9.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

気相成長装置の汚染量を測定する方法であつて、

気相成長装置のチャンバー内をHClガスによるベーパーエッキングによりクリーニングするベーパーエッキング工程と、

前記ベーパーエッキング後の前記チャンバー内にて所定の枚数のウェーハを1枚ずつ順次非酸化性雰囲気で熱処理する熱処理工程と、

前記熱処理工程で熱処理された各々のウェーハ表面上の金属不純物の濃度を前記気相成長装置の汚染量として測定する測定工程とを含み、

前記ベーパーエッキング工程及び前記熱処理工程を所定の回数繰り返しを行い、前記熱処理工程では各回同じウェーハを用いて各回で熱処理するウェーハの順番を変えないようにし、前記ベーパーエッキング工程及び前記熱処理工程を前記所定の回数繰り返し行った後に前記測定工程を行うことを特徴とする気相成長装置の汚染量測定方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

上記課題を解決するための、本発明の気相成長装置の汚染量測定方法は、

気相成長装置のチャンバー内をHClガスによるベーパーエッキングによりクリーニングするベーパーエッキング工程と、

前記ベーパーエッキング後の前記チャンバー内にて所定の枚数のウェーハを1枚ずつ順次非酸化性雰囲気で熱処理する熱処理工程と、

前記熱処理工程で熱処理された各々のウェーハ表面上の金属不純物の濃度を前記気相成長装置の汚染量として測定する測定工程とを含み、

前記ベーパーエッキング工程及び前記熱処理工程を所定の回数繰り返しを行い、前記熱処理工程では各回同じウェーハを用いて各回で熱処理するウェーハの順番を変えないようにし、前記ベーパーエッキング工程及び前記熱処理工程を前記所定の回数繰り返し行った後

に前記測定工程を行うことを特徴とする。